

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 4 月 1 日 (01.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/027845 A1

(51) 国際特許分類⁷: **H01L 21/205, F27D**
1/00, 11/02, H05B 3/62, H01L 21/22

式会社内 Tokyo (JP). 長内 長栄 (OSANAI, Hisaei); 〒
107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目 3 番 6 号 東京エ
レクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2002/009730

(22) 国際出願日: 2002 年 9 月 20 日 (20.09.2002)

(74) 代理人: 吉武 賢次, 外 (YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒
100-0005 東京都 千代田区 丸の内三丁目 2 番 3 号 富
士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG.

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELEC-
TRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤
坂五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP).

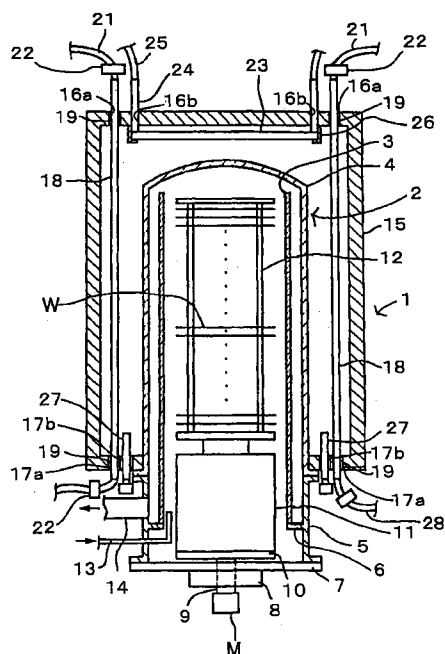
添付公開書類:
— 国際調査報告書

(72) 発明者: 斎藤 孝規 (SAITO, Takanori); 〒107-8481 東
京都 港区 赤坂五丁目 3 番 6 号 東京エレクトロン株

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: HEAT-TREATING APPARATUS

(54) 発明の名称: 熱処理装置



(57) Abstract: A heat-treating apparatus comprising a reaction chamber ac-
commodating an object to be treated, a heat-insulating body surrounding the
reaction chamber, holes defined in the heat-insulating body, annular spacer
members provided in the holes, and heater elements inserted in the annular
spacer members.

(57) 要約:

本発明の熱処理装置は、被処理体を収容するための反応室と、前記反応室を囲
むように設けられた断熱体と、前記断熱体に設けられた複数の孔と、前記複数の
孔の内部にそれぞれ設けられた複数の環状のスペーサ部材と、前記複数の環状ス
ペーサ部材内にそれぞれ挿入された複数のヒータエレメントと、を備える。

WO 2004/027845 A1